CATALYST FOR TRIMERIZING ETHYLENE AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE BY USING THE SAME

Publication number: JP2002200429

Publication date: 2002-07-16
Inventor: YOSHIDA (

YOSHIDA OSAMU; OKADA HISANORI; YAMAMOTO

TOSHIHIDE; MURAKITA YOSHIYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/22; B01J31/26; C07B61/00; C07C2/32;

C07C11/107; C07B61/00; **B01J31/16; B01J31/26; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00;** C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; B01J31/22; B01J31/26; C07C2/32;

C07C11/107

- European:

Application number: JP20010285187 20010919

Priority number(s): JP20010285187 20010919; JP20000333553 20001027

Report a data error here

Abstract of JP2002200429

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture 1-hexene from ethylene in high yield with high selectiv ity. SOLUTION: This catalyst is obtained by bringing a compound having two or more hydroxyl groups into contact with an alkyl group-containing compound to obtain a reaction product and bringing the reaction product into contact with the chromium complex shown by ACrBn (wherein n is an integer of 1-3: A is a neutral multidentate ligand having a tripodal structure; Cr is chromium atom; B is one or more selected from the group consisting of hydrogen atom, halogen atom and a straight or branched chain alkyl group).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特|期2002-200429 (P2002-200429A)

(43)公開日 平成14年7月16日(2002.7.16)

		120724711 177221 177200 (2002) 171207
(51) Int.Cl.7	設別記号	F I
ВО1 Ј 31/22		B 0 1 J 31/22 Z 4 G 0 6 9
31/26		31/26 Z 4 H 0 0 6
C 0 7 C 2/32		C07C 2/32 4H039
11/10	7	11/107
// CO7B 61/00	300	C 0 7 B 61/00 3 0 0
		審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特願2001-285187(P2001-285187)	(71) 出願人 000003300
		東ソー株式会社
(22)出顧日	平成13年9月19日(2001.9.19)	山口県新南陽市開成町4560番地
		(72)発明者 吉田 統
(31)優先権主根番号	身 特願2000−333553 (P2000−333553)	三重県桑名市新西方 5 -304
(32)優先日	平成12年10月27日(2000.10.27)	(72)発明者 岡田 久則
(33)優先權主張国	日本 (JP)	三重県四日市市垂坂町366-1
		(72)発明者 山本 敏秀
		三重県四日市市別名3 丁目 5 - 1
		(7%)発明者 村北 栄之
		三重県四日市市別名3 「目4-1
		最終頁に統
		I .

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】 2個以上のヒドロキシ基を有する化合物 とアルキル基含有化合物を接触させ、更に下式一般式 (1)

 $ACrB_n$ (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を接触させることにより得られる触媒を用いる。

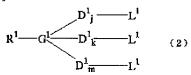
【特許請求の範囲】

【請求項1】2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物と、更に下記一般式(1) ACrB_n (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒。

【請求項2】三脚型構造を有する中性の多座配位子が、 下記一般式(2)

【化1】



(式中、j, k, mはそれぞれ独立して $0\sim6$ の整数である。 D^1 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^1 はそれぞれ独立して周期表 14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^1 は炭素またはケイ素、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基または炭素数 $6\sim10$ のアリール基を表す。)または下記一般式(3)【化2】

(式中、a,b,cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2個の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G²は窒素原子またはリン原子、R²は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】三脚型構造を有する中性の多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量化触媒。 【請求項4】アルキル基含有化合物が、下記一般式(4)

$R_n M X_n$ (4)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる

1種以上を表し、Xは水素原子、炭素数 $1\sim10$ のアルコキシド基、炭素数 $6\sim10$ のアリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】2個以上のヒドロキシ基を有する化合物が、炭素数1~20個の炭化水素基と2個以上のヒドロキシ基を有するジオールもしくはポリオール、または下式一般式(5)

$$M'(OH)_n$$
 (5)

(式中、M'は周期表の2族〜3族の元素で、nはM'の価数に等しい。)で示される化合物であることを特徴とする請求項1~4に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項6】2個以上のヒドロキシ基を有する化合物が、下式一般式(6)

【化3】

(式中、iは0~2000の整数であり、nは1~2000整数である。R³は水素または炭素数1~10のアルキル基であり、各々同一でも異なっていても良く、R⁴は水素またはヒドロキシル基であり、かつR⁴の少なくとも一つは必ずヒドロキシル基である。更に、iが1以上の時、交互共重合体、ランダム共重合体もしくはブロック共重合体である。)で示される化合物であることを特徴とする請求項1~4に記載のエチレンの三量化触域

【請求項7】請求項1~6に記載のエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化 触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関す る。更に詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDP E)の原料コモノマーとして有用な1ーへキセンをエチ レンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの 三量化触媒、及びその触媒を用いたエチレンの三量化方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報にはクロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシド及びドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハラ

イドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、金属アルキル化合物及び酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

【0003】また、特開平6-298673号公報には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシン及び/またはスチビンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。更に、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ビラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと 同時にポリエチレンが多く副生する欠点がある。特開平 6-239920号公報に記載の方法は、ポリエチレン の副生が少なく、この点ではかなり改善しているが、触 媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対し て極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすい ため取り扱いが難しく、更に反応終了後には着色成分を 除去するための処理または新たな装置を必要とする等、 工業的な触媒としては十分なものではなかった。特開平 8-59732号公報に記載の方法では、触媒の構成成 分である酸アミドまたはイミド化合物の化合物群の中で 活性を得るには、ある特定のイミド化合物(マレイミ ド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いた め触媒調製が煩雑であり、マレイミドは入手が難しいば かりか高価であり、経済性の面においても問題がある。 特開平6-298673号公報に記載の方法では、実施 例の再現性に問題がある。特開平10-7712号公報 に記載の方法は、触媒活性が低いという問題がある。特 開平10-231317号公報に記載の方法は、ポリエ チレンの生成が多く、オリゴマー中の1-ヘキセンの選 択性も低いという欠点がある。

【0005】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1ーヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造し、しかも取り扱いの容易なエチレンの三量化触媒、及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物と特定の多座配位子が配位したクロム錯体との接触によって得られる三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高い活性でエチレンの三量化反応

が進行し、高選択的に1-ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち本発明は、2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物と三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体との接触によって得られるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0008]

【発明の実施の形態】次に、本発明について更に詳しく 説明する。

【0009】本発明においては、エチレンの三量化触媒 を構成する一成分として、下記一般式(1)

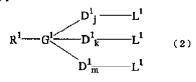
$$ACrB_n$$
 (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び炭素数1~10の直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体が用いられる。

【0010】ここで、クロム錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式(2)

[0011]

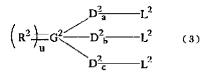
【化4】



(式中、j,k,mはそれぞれ独立して0~6の整数である。D¹はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L¹はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G¹は炭素またはケイ素、R¹は水素原子、炭素数1~10のアルキル基または炭素数6~10のアリール基を表す。)または下記一般式(3)

[0012]

【化5】



(式中、a,b,cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G²は窒素原子またはリン原子、R²は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子が好適なものとし

て挙げられる。

【0013】上記一般式(2)及び(3)において、D L及びD²としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルキル基類、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

【0014】一般式(2)及び(3)において、し1及 びし2で示される周期表14族、15族、16族または 17族元素を含有する置換基は特に限定されるものでは ないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、ブトキシ基等のアルコキシ基類、フェノキシ基、 2,6-ジメチルフェノキシ基等のアリールオキシ基 類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブ チルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、ト リルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、 ジエチルアミノ基、ビス (トリメチルシリル) アミノ基 等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジ アリールアミノ基類、メチルフェニル基等のアルキルア リールアミノ基類、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホ スフィノ基等のジアルキルホスフィノ基類、ジフェニル ホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等のジアリールホ スフィノ基類、メチルフェニルホスフィノ基等のアルキ ルアリールホスフィノ基類が挙げられる。

【0015】また、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等の周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基類が挙げられる。これらの複素環の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

【0016】一般式(2)におけるRIは特に限定されるものではないが、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、ベンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル基、アリル基、トリフルオロプロビル基等の炭素数1~10のアルキル基類、またはフェニル基、pーメチルフェニル基、pークロロフェニル基等の炭素数6~10のアリール基類が挙げられる。

【0017】上記一般式(2)及び(3)で示される三脚型構造を有する中性の三座配位子は特に限定されるものではないが、例えば、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を持つ多座配位子としては、トリス(メトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(メトキシメチル)プロパン、1,1,1ートリス(エトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(エトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(エトキシメチル)エタン、1,1,1ートリス(プロポキシ

メチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ブトキシメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (フェノキシメチル) エタン等の含酸素三座配位子類、1, 1, 1ートリス (メチルチオメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ブチルチオメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ブェニルチオメチル) エタン等の含イオウ三座配位子類、1, 1, 1ートリス (ジメチルアミノメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ジフェニルアミノメチル) エタン等の含窒素三座配位子類、1, 1, 1ートリス (ジフェニルホスフィノメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ジメチルホスフィノメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン、1, 1, 1ートリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン等の含リン三座配位子類が挙げられる。

【0018】更に、周期表14族、15族、16族また は17族元素を含有する複素環基を持つ多座配位子とし ては、トリフリルメタン、トリス (5-メチルー2-フ リル)メタン、トリス (5-エチル-2-フリル)メタ ン、トリス (5-74)ルー2ーフリル) メタン、(5-74)1,1-トリフリルエタン、トリフリルアミン、トリフ リルホスフィン、トリフリルホスフィンオキシド等の含 酸素三座配位子類、トリス(チエニル)メタン等の含イ オウ三座配位子類、トリ(1-ピラゾリル)メタン、ト リス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)メタン、ト リス(3,5ージイソプロビルー1ーピラゾリル)メタ ン、トリス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)メ タン、1,1、1-トリス(3,5-ジメチルー1-ピ ラゾリル) エタン、1,1,1-トリス(3,5-ジメ チルー1-ピラゾリル)プロパン、1、1、1-トリス (3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)ブタン、トリス (2-ピリジル)メタン、トリス(6-メチルー2-ピ リジル) メタン、トリス (2-ピリジル) アミン、トリ ス(2ーピリジル)ホスフィン、トリス(2ーピリジ ル) ホスフィンオキシド、トリス (2-ピリジル) ヒド ロキシメタン、トリス(1-イミダゾリル)メタン、ト リス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタン、ト リス(3,5-ジエチルー1ーピラゾリル)メタン、ト リス(3,4,5ートリメチルー1ーピラゾリル)メタ ン、トリス(3,5ージメチルー4-nーブチルー1-ピラゾリル) メタン、トリス (3-フェニル-5-メチ ルー1ーピラゾリル) メタン、トリス (3-(4-トリ ル) -5-メチル-1-ピラゾリル) メタン、トリス (3-(4-アニシル)-5-メチル-1-ピラゾリ ル)メタン、トリス(3-(2-ピリジル)-5-メチ ルー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ー(3ーピリ ジル) -5-メチルー1-ピラゾリル) メタン、トリス **(3-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリ** ル)メタン、トリス(3-フェニル-1-ピラゾリル) メタン、1ーメチルートリス(3ーフェニルー1ーピラ ゾリル) メタン、メチルートリス(3-エチルー1-ピ ラゾリル) メタン、メチルートリス (3-フェニルー1

ーピラゾリル) メタン、メチルートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ー(4ートリル) ー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ー(4ーアニシル) ー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ープロピルー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ーエチルー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ーメチルー1ーピラゾリル) メタン、トリス(3ーtーブチルー1ーピラゾリル) メタン等の含窒素三座配位子類が挙げられる。

【0019】本発明において、上記一般式(1)のBで用いられるハロゲン原子は特に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子等が挙げられる。また、直鎖もしくは分岐状のアルキル基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基またはフェニル基等が挙げられる。

【0020】上記一般式(1)で示されるクロム錯体の 具体的な例としては特に限定されるものではないが、例 えば、トリス (メトキシメチル) メタンクロムトリクロ ライド(III)、トリス(メトキシメチル)メタンク ロム(ベンジル)ジクロライド(III)、1、1、1 ートリス (メトキシメチル) エタンクロムトリクロライ ド(I I I)、1, 1, 1-トリス (エトキシメチル) エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス (ブトキシメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1, 1, 1-トリス (フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド(III)、トリフリルメ タンクロムトリクロライド(III)、1,1,1ート リス (メチルチオメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1,1,1-トリス(ジメチルアミノメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、トリス (ピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(II I)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メ タンクロムトリクロライド(III)、トリス(3,5 ージエチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラ **ゾリル)-メチル-メタンクロムトリクロライド(II** I)、トリス(3-フェニルー5-メチルー1ーピラゾ リル) メタンクロムトリクロライド (III)、トリス (3-(2-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリ ル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (3-(3-ピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリ ル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (3-(4-ピリジル)-5-メチルー1-ピラゾリ ル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (3-フェニル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリク ロライド(III)、トリス(3-(3-トリル)-5 ーメチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライ ド(III)、トリス(3ー(3ーアニシル)-5-メ

チルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (III)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリ ル) メタンクロム (ヒドリド) ジクロライド (II I)、トリス(3,5ージメチル-1-ピラゾリル)メ タンクロム (ベンジル) ジクロライド (III)、トリ ス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロム (エチル) ジクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリベンジル (III)、1,1,1-トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) エタンクロムトリクロライド (1 1 I)、トリス(3,5-ジイソプロピルー1-ピラゾリ ル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (3-イソプロピルー1-ピラゾリル) メタンクロムト リクロライド(| | | | | |)、トリス(3-エチル-1-ピ **ラゾリル) メタンクロムトリクロライド(III)、ト** リス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)メタンク ロムトリクロライド(III)、トリス(2-ピリジ ル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (6-メチルー2-ピリジル)メタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(2ーピリジル)アミンクロム トリクロライド(III)、トリス(1-イミダゾリ ル) メタンクロムトリクロライド(III)、1,1, 1ートリス (ジメチルホスフィノメチル) エタンクロム トリクロライド(III)、1,1,1-トリス(ジフ ェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1,1,1-トリス(ジエチルホスフィノ メチル) エタンクロムトリクロライド (III) 等が挙 げられる。

【0021】これらのうち触媒活性の面から、一般式 (1)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子 としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好まし く用いられ、より好ましくはトリス(3-(4-トリ ル)-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3-フェニル -1-ピラゾリル) メタン、トリス(3,5-ジメチル -1-ピラゾリル) メタン、トリス (3-フェニルー5 ーメチルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3-(2 ーピリジル) - 5 - メチル - 1 - ピラゾリル) メタン、 トリス(3-(3-ピリジル)-5-メチルー1-ピラ ゾリル) メタン、トリス(3-(4-ピリジル)-5-メチルー1 - ピラゾリル) メタンが用いられる。また、 Bとしてはハロゲン原子が好ましく用いられる。更に好 ましい三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した クロム錯体としては、3-(4-トリル)-1-ピラゾ リル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス (3-フェニル-1-ピラゾリル) メタンクロムトリク ロライド(III)、トリス(3,5-ジメチルー1ー ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(I I I)、 トリス(3-フェニルー5-メチルー1-ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(2ーピリジル) ~5~メチル~1~ピラゾリル) メタ

ンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(3 ーピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンク ロムトリクロライド(III)、トリス(3-(4-ピ リジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタンクロム トリクロライド(III)等が用いられる。

【0022】本発明において、上記の三脚型構造を有す る中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は特 に限定されるものではないが、例えば、多座配位子とク ロム化合物とから公知の錯体形成法「例えば、Inor g. Chem., 25, 1080 (1986) 等] によ り容易に合成することができる。この場合、使用できる クロム化合物としては特に限定されるものではないが、 例えば、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、 臭化クロム(III)、臭化クロム(II)、ヨウ化ク ロム(III)、ヨウ化クロム(II)、フッ化クロム (I I I)、フッ化クロム (I I)、トリス (テトラヒ ドロフラン) クロムトリクロライド(III)、トリス (1,4-ジオキサン)クロムトリクロライド(II I)、トリス(ジエチルエーテル)クロムトリクロライ ド(III)、トリス (ピリジン) クロムトリクロライ ド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムトリク ロライド(III)等が挙げられる。

【0023】前記の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0024】また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0025】更に別途合成法として、上記の方法により 合成した三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位し たクロムハロゲン錯体を原料に、アルキル金属化合物や 金属ヒドリド化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三 脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯 体を合成してもよい。 【0026】多座配位子が配位したクロム錯体は、通常 固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離 できる。更に、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を 行い、次いで乾燥しエチレンの三量化触媒の構成成分の 一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿しない 場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等に より沈殿させることができる。

【0027】本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ボリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子が有acialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである[化学選書 有機金属化学-基礎と応用ー、143頁(裳華房)]。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

【0028】本発明において使用されるアルキル基含有 化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記 一般式(4)

 $R_{p}MX_{q} \qquad (4)$

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であっ て、しかもp+gは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、R は炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる 1種以上を表し、Xは水素原子、炭素数1~10のアル コキシド基、炭素数6~10のアリール基及びハロゲン 原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示さ れる化合物が好適なものとして挙げられる。上記一般式 (4)において、炭素数1~10のアルキル基は特に限 定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基またはオ クチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に 限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エ トキシド基、ブトキシド基またはフェノキシド基等が挙 げられる。アリール基としては特に限定されるものでは ないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン 原子としては特に限定されるものではないが、例えば、 フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

【0029】なお、上記一般式(4) において、MがA 1で、pと qがそれぞれ1. 5のとき、A 1 $R_{1.5}$ $X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的にA 1_2 R_3 X_3 のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0030】上記一般式(4)で示されるアルキル基含 有化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリ チウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、se

cーブチルリチウム、tertーブチルリチウム、ジエ チルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチル クロロマグネシウム、エチルブロモマグネシウム、ジメ チル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボ ラン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、ト リエチルアルミニウム、トリーnーブチルアルミニウ ム、トリイソブチルアルミニウム、トリーnーヘキシル アルミニウム、トリーnーオクチルアルミニウム、トリ シクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチルアルミニ ウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルア ルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシクロヘキ シルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキ シクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチル アルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウムクロ リド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチル アルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセス キクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチ ルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジ クロリド等が挙げられる。これらのうち入手の容易さ及 び活性の面から、トリアルキルアルミニウム化合物が好 ましく用いられ、更に好ましくはトリエチルアルミニウ ム、トリーnーブチルアルミニウム、トリイソブチルア ルミニウム、トリーローヘキシルアルミニウムやトリー n-オクチルアルミニウム等が用いられる。これらのア ルキル基含有化合物は単独で使用し得るのみならず、二 種以上を混合して用いることも可能である。アルキル基 含有化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0. 1~10000当量であり、好ましくは3~3000当 量、より好ましくは5~2000当量である。

【0031】本発明で用いられる2個以上のヒドロキシ基を有する化合物として、炭素数1~20個の炭化水素基と2個以上のヒドロキシ基を有するジオールもしくはボリオールを用いることができ、特に限定されるものではないが具体的には、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、イプタンジオール、オクタンジオール、デカンジオール、エイコサンジオール、ブタントリオール、ボクタントリオール、オクタデカンペンタオール等が挙げられる。更に、2個以上のヒドロキシ基を有する化合物として、下式一般式(5) M'(OH)。

(式中、M'は周期表の2族〜3族の元素で、nはM'の価数に等しい。)も用いることができ、特に限定されるものではないが具体的には、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム、水酸化アルミニウム等が挙げられる。また、更に本発明で用いられる2個以上のヒドロキシ基を有する化合物としては、下式一般式(6)

[0032]

【化6】

(式中、iは0~2000の整数であり、nは1~2000整数である。R³は水素または炭素数1~10のアルキル基であり、各々同一でも異なっていても良く、R⁴は水素またはヒドロキシル基であり、かつR⁴の少なくとも一つは必ずヒドロキシル基である。更に、iが1以上の時、交互共重合体、ランダム共重合体もしくはブロック共重合体である。)で表わされるものも用いることができる。特に限定されるものではないが具体的には、例えば、ポリビニルアルコールやエチレン・ビニルアルコール共重合体等が挙げられる。

【0033】本発明で用いられる2個以上のヒドロキシ基を有する化合物は、クロム錯体1モルに対してヒドロキシル基が0.01~10000当量であり、好ましくは0.05~5000当量、より好ましくは0.1~1000当量である。

【0034】本発明におけるエチレンの三量化反応は、例えば2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物を前もって接触させ、前記のクロム錯体と接触させた後、エチレンを接触させることにより行うことができる。この場合の接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応の原料であるエチレンの存在下に2個以上のヒドロキシ基を有する化合物を接触させ、更にクロム錯体を接触させて三量化反応を開始する方法、または2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物を接触させ、クロム錯体を接触させた後にエチレンと接触させて三量化反応を行う方法がとられる。これらの混合順序は特に制限されない。

【0035】当該三量化触媒を調製する際のクロム錯体 の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり 0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは 〇.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用され る。0.001マイクロモルより小さい触媒濃度では十 分な活性が得られず、逆に100ミリモルより大きい触 媒濃度では触媒活性が増加せず経済的でない。当該三量 化触媒を調製する際の温度は-100~250℃、好ま しくは0~200℃である。接触時間は特に制限され ず、1分~24時間、好ましくは2分~2時間である。 接触時に用いられる溶媒としては、例えば、ブタン、ペ ンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタ ン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロヘキサ ン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デカリン 等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレ ン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、ク ロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類

及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即ち、1ーヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。なお、接触時のすべての操作は、窒素下で行なうことが望ましい。原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0036】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、0.01~3000kg/cm²である。反応時間は、通常、5秒~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば、窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0037】本反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するボリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

[0038]

【実施例】以下に、本発明を実施例により詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本 発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0039】IR測定: IRは、島津製作所製 赤外分 光光度計 (FTIR-8100)を用いて、ヌジョール 法で測定した。

【0040】ガスクロマトグラフィーによる分析: 反応 液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製 のガスクロマトグラフ (GC-14A) を用いて分析し た。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度280℃、検出器温度280℃に設定し、内部標 準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.0μ1注入した後、カラムの 温度を40℃から250℃まで昇温することにより行った。

【0041】また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.5μ1注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで昇温することにより行った。

【0042】気体中に含まれる生成物は、クロムバック製 A1₂O₃/KC1のカラムを装着した島津製作所製ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃及びカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2m1注入することにより行った。

【0043】参考例1

内容積100mlのシュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス (3,5-ジメチルー1ーピラゾリル) メタン 126mg、トリス (テトラヒドロフラン) クロムトリクロライド (III) 143mg、テトラヒドロフラン20mlを加え、窒素雰囲気下で12時間攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス (3,5-ジメチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (III) を得た (IR (ヌジョール):1565cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

【0044】参考例2

内容積100m1のシュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118 (1970) に記載の方法を用いて合成した三脚型構造を有するトリス (3-フェニルー5ーメチルー1ーピラゾリル) メタン 346mg、トリス (テトラヒドロフラン) クロムトリクロライド (III) 255mg、テトラヒドロフラン5mlとトルエン20mlを加え、窒素雰囲気下で24時間95℃で攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス(3-フェニルー5ーメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリクロライド (III) を得た (IR (KBr):1566cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Bと称する。

【0045】参考例3

内容積100mlのシュレンク管に、J. Amer、C hem. Soc., 92, 5118 (1970) に記載 の方法を用いて合成した三脚型構造を有するトリス (3 ーフェニルー1ーピラゾリル) メタン 120mg、ト リス (テトラヒドロフラン) クロムトリクロライド (I

II) 94mg、トルエン18mlを加え、窒素雰囲気 下で12時間100℃で撹拌した。 生成した結晶をろ別 し、トリス(3-フェニルー1-ピラゾリル) メタンク ロムトリクロライド(III)を得た(IR(KB r):1540cm-1)。以下、この錯体を錯体Cと称 する。

【0046】参考例4

内容積100mlのシュレンク管に、J. Amer. C hem. Soc., 92, 5118 (1970) に記載 の方法を用いて合成した三脚型構造を有するトリス (3) - (4-トリル) - 1-ピラゾリル) メタン 400m g、トリス (テトラヒドロフラン) クロムトリクロライ ド(III) 295mg、トルエン30mlを加え、窒 素雰囲気下で12時間100℃で撹拌した。生成した結 晶をろ別し、トリス(3-(4-トリル)-1-ピラゾ リル) メタンクロムトリクロライド (III) を得た (IR(KBr):1541cm-1)。以下、この錯体 を錯体Dと称する。

【0047】比較例1

温度計及び攪拌装置を備えた内容積1000m1のステ ンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aと トリーnーオクチルアルミニウムのトルエン溶液を導入 した後、トルエンを加えて反応液量を250mlとし た。1000rpmで撹拌しながら反応容器内の温度を 80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で40 kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反 応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、 反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活 させて反応を停止した。反応容器を室温まで冷却し、次 いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条 件及び結果を表1,表2に示す。

【0048】実施例1

温度計及び攪拌装置を備えた内容積1000m1のステ ンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを 入れ、トリーローオクチルアルミニウムとエチレングリ コールを混合した均一なトルエン溶液を加えた後、トル エンを加えて反応液量を250mlとした。1000r pmで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、 反応器内のエチレン圧をゲージ圧で40kg/cm²に

維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った 状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水 を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停 止した。反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。 反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロ マトグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表 1.表2に示す。

【0049】実施例2

温度計及び攪拌装置を備えた内容積1000mlのステ ンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを 入れ、トリーn-オクチルアルミニウムとAl(OH) 3を混合した均一なトルエン溶液を導入した後、トルエ ンを加えて反応液量を250mlとした。1000rp mで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反 応器内のエチレン圧をゲージ圧で40kg/cm²に維 持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状 態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を **窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止** した。反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反 応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマ トグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表 1、表2に示す。

【0050】実施例3

温度計及び攪拌装置を備えた内容積1000m1のステ ンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを **入れ、トリーnーオクチルアルミニウムとポリビニルア** ルコール (Mn=500) 127mgを混合したトルエ ン溶液を導入した後、トルエンを加えて反応液量を25 0mlとした。1000rpmで撹拌しながら反応容器 内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲー ジ圧で40kg/cm2に維持するように導入し続け、 これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なっ た。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することによ り触媒を失活させて反応を停止した。反応容器を室温ま で冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中 に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析 した。反応条件及び結果を表1、表2に示す。

[0051]

【表1】

実験番号 ヒドロキシイ	<u>1. エチレン</u>	3量化反	応の仕込む	7組成
[CI:m-()	験番号		ヒドロ	キシ化す

実験番号		ヒドロキシ化合物/Cr
	錯体	[モル比]
比較例1	維体A	0(なし)
実施例1	錯体A	60(エチレングリコール)
実施例2	錯体A	6(AI(OH)3)
実施例3	錯体A	ポリビニルアルコール(*1)

(*1)ポリビニルアルコール(Mn=500)を127mg使用。

アルキル基含有化合物: 比較例1、実施例1~3で、360mmol/jの(n-C8H17)3AIのトルエンを6.25ml使用、

表2. エチレン3量化反応の結果

実験番号	1-ヘキセン活性		オリマー/生成物	オリゴマ	オリゴマー分率 [wt%]		
	[kg/g-Cr/h]	[kg/I-触媒溶液/h]	wt%	C4	C6	CB以上	[wt%]
比較例1	11.4	14.3	<0.1	0.1	77.2	22.7	99.8
実施例1	17.7	22.3	<0.1	0,1	B2.0	17.9	99.7
実施例2	26.8	33.8	0.1	0.1	B6.6	13.3	99.B
実施例3	29.6	37.4	0.1	0.1	80.8	19,1	99.6

(*1)C6オリゴマー中の1ーヘキセン

反応条件: 錯体(6.25 µ mol); AI/Crモル比(300); エチレン(40kg/cm2); 反応液量(250ml); 80℃; 30分; 攪拌速度(1000rpm).

比較例2

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例2で合成した錯体Bとトリー
nーオクチルアルミニウムのトルエン溶液を導入した
後、トルエンを加えて反応液量を80m1とした。1000rpmで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表3,表4に示す。

【0052】実施例4

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例2で合成した錯体Bを入れ、トリーn-オクチルアルミニウムとA1 (OH)₃を混合した均一なトルエン溶液を導入した後、トルエンを加えて反応液量を80m1とした。1000rpmで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表3,表4に示す。

【0053】実施例5

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150m1のガラス

製耐圧反応容器に、参考例3で合成した錯体Cを入れ、トリーローオクチルアルミニウムとA1 (OH) ®を混合した均一なトルエン溶液を導入した後、トルエンを加えて反応液量を80mlとした。1000rpmで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表3,表4に示す

【0054】実施例6

温度計及び撹拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例4で合成した錯体Dを入れ、トリーnーオクチルアルミニウムとA1 (OH)3を混合した均一なトルエン溶液を導入した後、トルエンを加えて反応液量を80m1とした。1000rpmで撹拌しながら反応容器内の温度を80℃にして、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で5kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。反応容器と定より触媒を失活させて反応を停止した。反応容器と定温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。反応条件及び結果を表3,表4に示す。

[0055]

【表3】

寮3. エチレン3量化反応の仕込み組成					
突験番号		ヒドロキシ化合物/C			
	錯体	モル比			
比較例2	強体: 3	0(なし)			
安施例4	請休(3)	6(Al(OH)3)			
実施例5	循体C	6(AI(OH)3)			
実施例6	結体D	6(Al(OH)3)			

アルキル基合有化合物: 比較例2、実施例4~6で、360mmol/1の(n-C8H17)3AIのトルエンを6.25ml使用。

表4. エチレン3量化反応の結果

実験番号	1/	ヘキセン活性	ポリマー/生成物	利归:	マー分率 [v	vt%]	α-純度(*1)
	[kg/g-Cr/h]	[kg/l-触媒溶液/h]	[wt%]	C4	Çß	C8以上	wt%]
比較例2	1.4	5.0	₹0.1	12.0	65.2	22.7	99.8
実施例4	3.6	13.0	0.1	0.1	89 <i>2</i>	10.7	99.8
実施例5	4.7	16.5	0.1	0.1	89.5	10.4	99.8
実施例6	3.7	13.3	0.1	0.1	87.2	12.7	99.8

(*1)06オリゴマー中の1ーヘキセン。

反応条件: 錯体(6.25 μ mol); Al/Crモル比(360); エチレン(bkg/om2); 反応液量(80ml); 80℃; 30分; 攪拌速度(1000rpm).

【発明の効果】本発明によれば、2個以上のヒドロキシ基を有する化合物とアルキル基含有化合物を接触させ、 更に三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とを接触させることにより得られるエチレンの

三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1 ーヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 46069 AA06 BA21A BA21B BA22A

BA22B BA27A BA27B BB05A BB05B BC16A BC16B BC58A BC58B BE01A BE01B BE06A BE06B BE13A BE13B BE22A BE33A BE34B BE35A BE38A BE38B BE40A BE45A BE46B

BE48A CB47 4H006 AA02 AC21 BA09 BA14 BA29 BA44 BA47 BA63 BA81

4H039 CA19 CL19